

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年9月30日(30.09.2021)



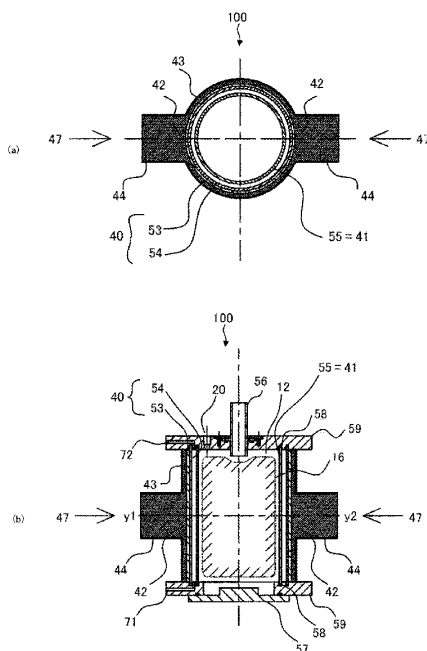
(10) 国際公開番号

WO 2021/192810 A1

- (51) 国際特許分類:
B08B 7/00 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
H05H 1/46 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/007258
- (22) 国際出願日: 2021年2月26日(26.02.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-051160 2020年3月23日(23.03.2020) JP
- (71) 出願人: 株式会社エス・エス・ティ(SST INC.)
[JP/JP]; 〒2760049 千葉県八千代市緑が丘 1
丁目 2 0 番地 1 5 Chiba (JP).
- (72) 発明者: 高松 利行(TAKAMATSU Toshiyuki).
- (74) 代理人: 福地 武雄(FUKUCHI Takeo); 〒1500043
東京都渋谷区道玄坂一丁目 2 0 番 2 号 アライ
アンスビル渋谷壱番館 5 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,

(54) Title: HIGH FREQUENCY REACTION TREATMENT DEVICE AND HIGH FREQUENCY REACTION TREATMENT SYSTEM

(54) 発明の名称: 高周波反応処理装置および高周波反応処理システム



(57) Abstract: Provided are a high frequency reaction treatment device and high frequency reaction treatment system capable of reducing energy loss in electromagnetic waves that pass through a propagation line while being continuously fed back thereto in a loop. The present invention comprises: an outer container (40) which is formed from a dielectric material and the internal space of which can be closed by two end surfaces; a coating conductor (43) that is formed from a conductive material and forms a spacial region between the coating conductor (43) and the outer surface of the dielectric outer container (40), with the potential of the coating conductor (43) being kept to be equal to the high frequency line grounding potential; one or more high frequency coupling parts (42) provided at an arbitrary position on the outer surface of the coating conductor (43); and one or two or more dielectric inner containers (41) that are formed from a dielectric material, do not contact the inner surface of the dielectric outer container (40), and are provided at a position at which incoming high frequency waves are received via the high frequency coupling part(s) (42), the internal space thereof being able to be closed by two end surfaces. Reaction treatment is conducted in the internal space of the dielectric inner container(s) (41) by electromagnetic waves introduced by the high frequency coupling part(s) (42).

WO 2021/192810 A1

[続葉有]

MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：伝搬線路を連続的にループ状に帰還し通過する電磁波のエネルギーの損失を低減できる高周波反応処理装置および高周波反応処理システムを提供する。誘電性材料で構成され、2つの端面により内腔を閉鎖することができる外容器（40）と、導電性材料で構成され、誘電体外容器（40）の外面との間に空間領域を形成する高周波線路接地電位と同電位に保たれた被覆導体（43）と、被覆導体（43）の外面の任意の位置に設けられた1または2以上の高周波結合部（42）と、誘電性材料で構成され、誘電体外容器（40）の内側面に接さず高周波結合部（42）を通して飛来する高周波を受ける位置に設けられかつ2つの端面により内腔を閉鎖することができる1または2以上の誘電体内容器（41）と、を備え、誘電体内容器（41）の内腔において高周波結合部（42）より導入される電磁波により反応処理を行なう。